

GaN 200 CMP Slurry



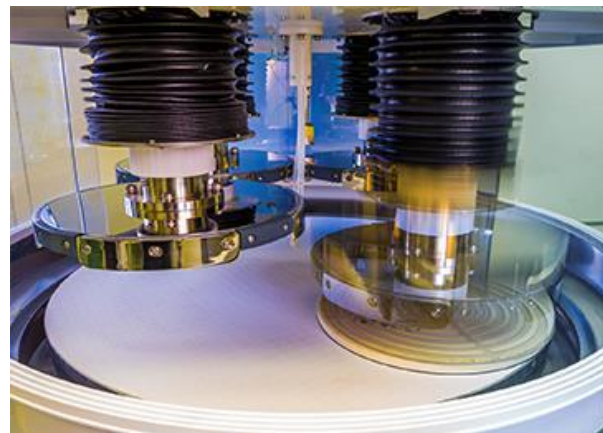
仏国サンゴバン社のGaN用CMPスラリーGaiN 200は、GaNウェハの化学機械的平坦化(CMP)における研磨プロセスを最適化するために特別に設計されています。特許出願中のナノ研磨スラリーであり、全体の研磨時間を大幅に短縮します。サンゴバン社は、当社の豊富な材料プラットフォームと配合の専門知識を活用して、高い研磨レートと優れた表面仕上げを達成できるGaNウェハ研磨アプリケーションを開発しました。

サンゴバン社GaiN CMPスラリーは、表面粗さを2Å以下(AFMで測定)を実現することにより、ウェハ表面の傷やピッチングを完全に排除します。GaiN 200は、2インチと4インチGaNウェハ上のEPIレディに対応します。

高い研磨レートが特徴で、GaiN 200 CMPスラリーは競合製品よりも4倍速く研磨でき、その結果、表面へのダメージが少なくなります。

【GaiN 200の特徴】

- 優れた研磨レート
- 傷やピットの無い表面仕上げ Ra<2Å
- 安定した分散特性
- Ready-to-use スラリー
- 一貫した品質のためにISO認証
- ウェーハ表面全体にわたる均一な品質
- 知識の豊富なアプリケーションエンジニアが技術サポートを提供



販売代理店:ケメットジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウエスト21階

TEL:043-21-9911 FAX:043-213-9932 INFO:info@kemet.jp